国际先进光刻技术研讨会邀请函
International Workshop on Advanced Patterning Solutions
Invitation Letter

光刻是集成电路制造领域的关键技术之一，也是衡量产业发展水平的重要指标。为了加强光刻技术领域的交流，促进业内合作，开拓研发思路，解决技术难题，推动行业发展，鉴于前两届国际先进光刻技术研讨会的良好反响，中国集成电路创新联盟和中国光学学会拟定于2020年11月5-6日在成都举办第四届“国际先进光刻技术研讨会（International Workshop on Advanced Patterning Solutions）”。会议将集中研讨先进光刻技术的热点问题，在浸没式，极紫外（EUV）光刻工艺，仿真，材料，测试，设备，设计优化等方面为大家提供技术研讨和交流的平台。本次会议仍将是高水平的国际技术研讨会，会议的详细信息请参见会议官网www.iwaps.org。

本次会议的发言人来自国内外业界的顶级专家。本次会议得到了国内外知名企业、研究机构和高校的大力支持。

我们很荣幸地邀请您参加本次大会。

会议相关事项：
1. 会议时间：2020年11月5-6日。
2. 会议地点：四川省成都市双流区川投国际酒店。
3. 注册费用：2400元/人，集成电路产业技术创新联盟成员单位1800元/人，学生1200元/人。9月30日前注册费：2000元/人。
4. 会议详情请及时登录本次会议官方网站，并请随时留意最新会议日程（www.iwaps.org）。
5. 可使用微信扫描二维码进行报名。

期待您的莅临！

IWAPS 2020组委会